# 層状 SnO へのアンモニアインターカレートとその評価

Ammonia intercalation into layered SnO thin films and their characterization

## 辛 佳和 (電気電子工学科)

Yoshikazu Shin

### 高機能デバイス研究室 指導教員 相川 慎也 准教授

#### 1. 緒言

SnO<sub>x</sub> 系材料は両極性を示すことから, Snの酸化状態を制御することで同一材料での pn 接合を用いた CMOS や透明太陽光電池を実現できる材料として注目されている. p 型伝導を示す SnOの価電子帯端(VBM)は Sn 5s 軌道で構成され, バンド分散が大きく, 有効質量が軽い. そのため, 高い正孔移動度を持つ p 型酸化物が期待できる[1]. しかし, SnO はバンドギャップが約 0.7 eVと小さく, 薄膜の透明性と移動度がトレードオフの関係にあるため, 透明デバイスとしての応用が現状難しい[2].

この問題に対し、Hu らは、層状構造を有する SnO の層間に CH4、NH3、CH3OH をインターカレートすることで、層間距離が増加し、バンドギャップと電気特性が向上する理論計算を報告している[2]. これらの3種類の分子において、CH4は標準状態で気体であるため扱いが困難であり、CH3OH は分子量が他の二つと比較して大きいため、インターカレートが難しいと考えられる.

そこで本研究では、CH3OH より分子量が小さく、扱いが比較 的容易な NH3を用いて、SnO の層間へのインターカレートを実験 的に行い、層間隔の拡大に伴うバンドギャップの拡張と電気特性 の向上を目指した。

### 2. 実験方法

SnO をスパッタリングにて成膜後,ホットプレートを用い,大気中 250 ℃,45 分アニールを行った.さらに,密閉容器内に SnO 薄膜および 25%アンモニア水を 1 ml を封入し,加圧アニールを400 ℃,60 分行った.

結晶構造と結晶方位は X 線回折装置(XRD)を用いて評価した.また,局所的な分子構造と層間距離は Raman 分光装置を用い,薄膜の電気特性はホール測定より評価を行った.

#### 3. 実験結果および考察

Fig. 1 に大気アニールのみ、および大気アニール後に加圧アニールを施した SnOx 膜の XRD パターンを示す。 2つの試料において Sn と SnO の結晶構造が存在していることがわかる。 また、アンモニア水での加圧アニール処理前後においてスペクトルのピーク数および位置が変化していないことから、 Sn と SnO の結晶が加圧アニールによってダメージを受けていないと言える。

Fig. 2 にそれぞれの SnOx 膜の Raman スペクトルを示す. 112 cm<sup>-1</sup>(a), および 216 cm<sup>-1</sup>(b) で確認されたピークは SnO に起因するものであり, それぞれの振動モードは B<sub>1g</sub>および A<sub>1g</sub> mode である. このことから, 2つの薄膜とも SnO の存在が確認された. 加圧アニール後の A<sub>1g</sub>, B<sub>1g</sub> ピークは, ともに高波数側にシフトした. これはアンモニア分子が層間にインターカレートされたことにより層間隔が拡大し, Sn-Sn のローンペアに作用するクーロン斥力が弱まることで, 酸素原子間の距離が縮まったためだと考えられる. つまり, Sn と O で構成される層が押しつぶされた結果, 層間隔が拡大したと考えられる.

Table 1 にそれぞれの SnOx 膜の Hall 測定の結果を示す. 加圧 アニールを行った膜は正孔移動度が約 6 倍増加していることが 確認された. これは, 加圧アニール処理により面内の O 2p/Sn 5s における軌道重なり強度が高まったことでバンド幅が大きくなり, 正孔の有効質量が減少したためだと考えられる.

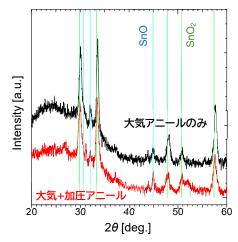


Fig. 1 大気アニールと加圧アニールを施した SnO 膜の XRD パターン

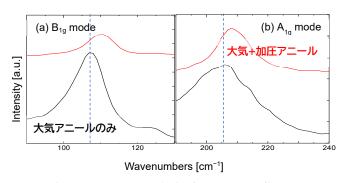


Fig. 2 大気アニールのみ, および大気+加圧アニールを施した  $SnO_x$  膜の Raman シフト:(a)  $B_{,g}$  mode (b)  $A_{,g}$  mode.

Table 1 大気アニールのみ,および大気+加圧アニールを施した  $SnO_x$  膜の電気特性

アニール	Hall mobility (cm²/Vs)	Carrier density (cm <sup>-3</sup> )	Conduction type
大気	0.17	9.9 × 10 <sup>18</sup>	р
大気+加熱	1.1	2.7 × 10 <sup>18</sup>	р

### 4. 結論

本研究では、SnO 層間へのアンモニアインターカレートにより、バンドギャップの拡張と電気特性の向上を目指した。アンモニア水を封入した加圧アニール処理を施すことで、SnO の層間にアンモニア分子が層間にインターカレートされたことが Raman 分校の結果より示唆された。また、Hall測定よりインターカレートに基づく電気特性の向上が確認された。

## 5. 参考文献

- [1] R. Barros, et al., Nanomaterials 9, 320 (2019).
- [2] Y. Hu et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 14, 25671-25677 (2022).